

	Kim Hyun Soo
氏名	金顯洙
授与学位	博士(工学)
学位授与年月日	平成9年3月25日
学位授与の根拠法規	学位規則第4条第1項
研究科、専攻の名称	東北大学大学院工学研究科(博士課程)金属工学専攻
学位論文題目	Fe ₂ O ₃ -TiO ₂ 系人工不働態皮膜の耐食性と光電気化学的性質に関する研究
指導教官	東北大学教授 杉本克久
論文審査委員	主査 東北大学教授 杉本克久 東北大学教授 橋本功二 東北大学教授 八田有尹 東北大学教授

論文内容要旨

Fe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜には、強酸溶液中でも高い耐食性を示す高性能な防食被膜になることや高い化学的安定性と高い光電流応答特性が同時に得られる半導体電極になることが、期待されている。そこで本研究では、MOCVD法によりFe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜を形成し、その皮膜の組織と耐食性の関係を定量的に明らかにした上で、皮膜の光電気化学的性質を耐食性と関連させて調べることを主な目的とした。本論文は全編6章より構成されており、以下に各章の概要を述べる。

第1章 序論

本章では、人工不働態皮膜の研究動向、本研究の背景および目的について述べている。本研究の目的は、(1) MOCVD法によりFe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜を形成し、その耐食性を膜組成の関数として定量的に明らかにすること、(2) イオンビームスパッタ法およびアーキ溶解鋳造法により作製したFe-Ti合金の不働態皮膜とFe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜の耐食性を比較すること、そして(3) Fe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜の光電気化学的性質を耐食性と関連させて調べることである。

第2章 実験方法

本章では、Fe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜の作製法、Fe-Ti合金の作製法、試料の分析法、耐食性の評価法および光電気化学的測定方法について述べている。

Fe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜は減圧MOCVD法により、Fe-Ti合金はイオンビームスパッタ法およびアーキ溶解鋳造法により作製した。作製された試料はエリプソメトリー、ICPS、XPS、AES、TEM、ED、OM、XRDなどにより分析した。その耐食性はHCl中の浸漬試験、H₂SO₄およびHCl中の電気化学的測定などにより評価した。Fe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜の定電位分極下での溶解速度は、1kmol·m⁻³H₂SO₄中でエリプソメトリーにより求めた。Fe-Ti合金の不働態皮膜とFe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜の耐食性を比較するため、5kmol·m⁻³HCl中で定電位分極試験を行った。Fe₂O₃-TiO₂系人工不働態皮膜の光電気化学的性質は、酸性、中性およびアルカリ溶液中での光電流の電位依存性ならびに光電流の波長依存性を調

べた。また、皮膜をアニーリングしたとき光電流応答特性の変化についても調べた。

第3章 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の耐食性

本章では、減圧 MOCVD 法による $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の耐食性と膜組成の関係について述べている。

MOCVD 法を用いて全組成範囲の $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜を作製することができた。XPS 分析によって皮膜中の各元素の化学結合状態を調べた結果、Fe は Fe_2O_3 を主成分として FeOOH を含んだ状態で、Ti は TiO_2 の状態で存在していた。また、O は M-O 結合を主成分として M-OH 結合とわずかな割合の C との結合状態で存在していた。623 K で形成された Fe_2O_3 薄膜の結晶構造はスピネル構造を有する $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 、 TiO_2 薄膜はアナターゼ構造の $\beta\text{-TiO}_2$ であった。また、Ti(IV) カチオン分率が約 0.70 までの $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜はスピネル構造、0.70 以上の皮膜はアモルファス構造であった。図 1 は各基板温度で形成した $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の 5 $\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ HCl 中での膜厚減少速度と Ti(IV) カチオン分率との関係を示す。膜厚減少速度は基板温度が高いほど、また、同じ基板温度の時には Ti(IV) カチオン分率が高いほど、減少した。基板温度 673K で析出した皮膜は Ti(IV) カチオン分率が 0.32 になると、5 $\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ HCl 中で溶解せず、極めて優れた耐食性を示した。このように基板温度が高いほど耐食性が向上するのは、合成温度が高くなるとより緻密な皮膜が得られるためと考えられる。 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜は 1 $\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ H_2SO_4 中でアノード分極すると広い不働態域を示した。しかし、カソード分極したときには、 Fe_2O_3 成分の還元によって溶解した。図 2 は $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜を 1 $\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ H_2SO_4 中で定電位分極したときの各電位での溶解速度と電極電位の関係を示す。皮膜は 0.6V 以上のアノード分極域側ではほとんど溶解しないが、カソード分極域では Fe_2O_3 成分の還元による溶解が起こった。このカソード分極域での溶解速度は電位が高くなるほど、また、同じ電位では Ti(IV) カチオン分率が大きいほど、減少した。

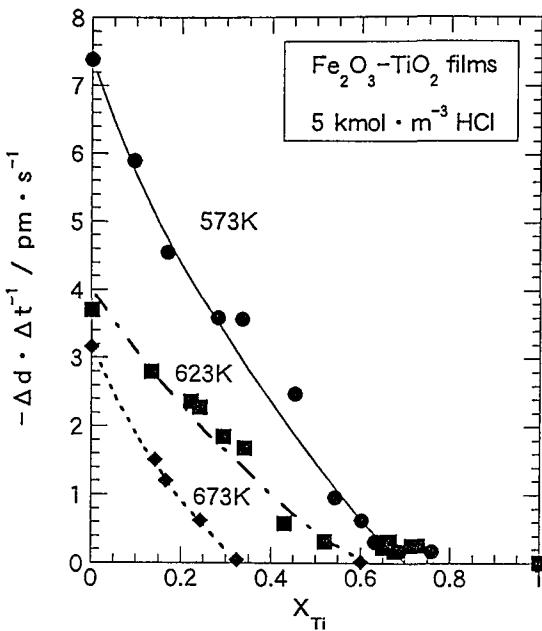


Fig.1 Dissolution rate, $-\Delta d \cdot \Delta t^{-1}$, in 5 $\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ HCl as a function of cationic fraction of Ti, X_{Ti} , for $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ films formed at 298K.

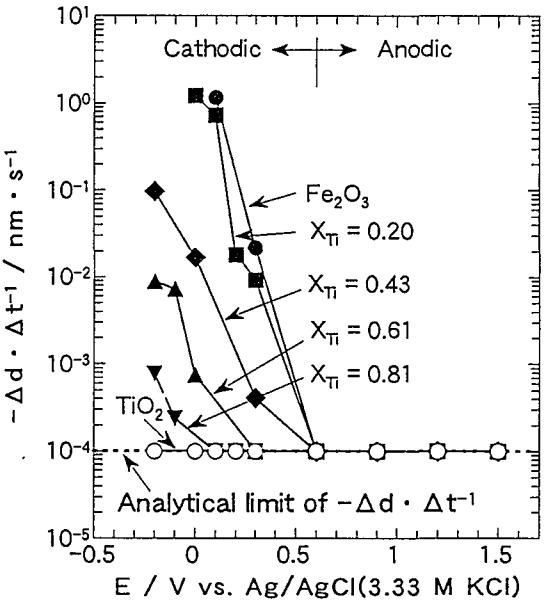


Fig.2 Dissolution rate, $-\Delta d \cdot \Delta t^{-1}$, for $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ films deposited at 623K as a function of potential, E, in deaerated 1 $\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ H_2SO_4 .

第4章 Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜と Fe-Ti 合金の不働態皮膜の耐食性の比較

本章では、イオンビームスパッタ法およびアーカ溶解法により作製した Fe-Ti 合金の不働態皮膜の耐食性を Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜のそれと比較した。

イオンビームスパッタ法により作製された Fe-Ti 合金薄膜はアモルファス、アーカ溶解铸造法により作製された Fe-Ti 合金は結晶質であった。これらの合金を $5 \text{ kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ HCl 中でアノード分極したところ、不働態を示すのはスパッタ Fe-Ti 合金薄膜では 39 at%以上のチタンを含むもの、アーカ溶解 Fe-Ti 合金は 57 at%以上のチタンを含むものであった。図 3 には Fe-Ti 合金の不働態皮膜および Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜の $5 \text{ kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ HCl 中での溶解速度と両者の皮膜中の Ti(IV)カチオン分率の関係を示す。 Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜および Fe-Ti 合金の不働態皮膜の溶解速度は、いずれも Ti(IV)カチオン分率が高くなるにつれて減少している。しかし、同じ Ti(IV)カチオン分率での溶解速度はスパッタ Fe-Ti 合金の不働態皮膜がアーカ溶解 Fe-Ti 合金の不働態皮膜よりやや小さいが、 Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜の溶解速度は Fe-Ti 合金の不働態皮膜のそれより約 30-40 倍くらい小さい。すなわち、 Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜は Fe-Ti 合金の不働態皮膜よりも極めて優れた耐食性を示した。これは、不働態皮膜の結晶構造の違いによるものと考えられる。

第5章 Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜の光電気化学的特性

本章では、 Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜の酸性、中性、およびアルカリ溶液中での光电流応答特性を耐食性と関連させて調べた。また、アモルファス構造の皮膜をアニーリングして結晶化させたときの光电流応答特性の変化についても調べた。

Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜は n 型半導体特性を示した。図 4 は Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜を電極としたときの $0.5 \text{ kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ H_2SO_4 中での最大量子効率と Ti(IV)カチオン分率との関係を示す。 Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜の最大量子効率は、Ti(IV)カチオン分率が大きくなるにつれて減少するが、0.70-0.95 の皮膜では再び増加した。しかし、この皮膜をアニーリングして結晶化させると、光电流および量子効率は減少した。その差は光电流スペクトルに現れ、アニーリングしない皮膜は低い光子エネルギーから高い光子エネルギーまで広い領域にわたって光电流が流れるが、アニーリングした皮膜の光电流は 4.0 eV 付近でピークを示した後、高い光子エネルギー側では急激に減少した。 Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態皮膜のバンドギャップは Ti(IV)カチオン分率の増加につれて直線的に大きくなつた。また、 Fe_2O_3 皮膜のフラットバンド電位は約 -83 mV/pH、 TiO_2 皮膜のそれは約 -69 mV/pH の関係で変化した。図 5 には Fe_2O_3 - TiO_2 系人工不働態

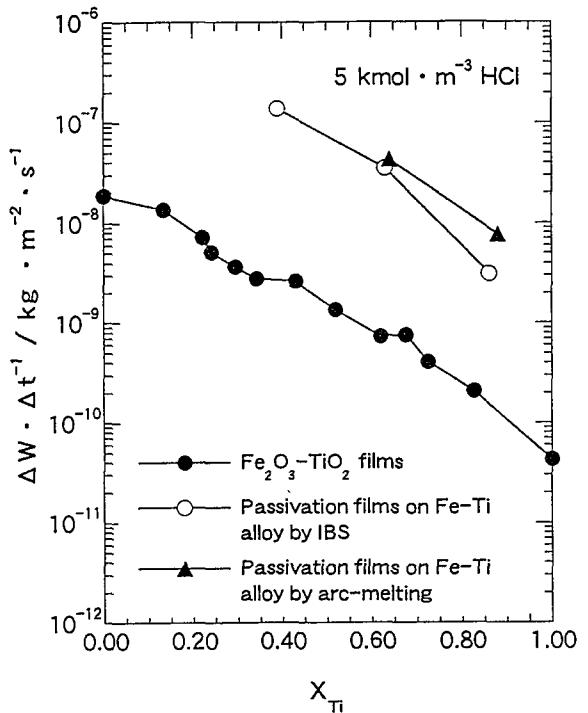


Fig.3 Dissolution rate, $\Delta W \cdot \Delta t^{-1}$, in $5 \text{ kmol} \cdot \text{m}^{-3}$ HCl as a function of cationic fraction of titanium on anodic oxidation films of Fe-Ti alloys and Fe_2O_3 - TiO_2 films.

皮膜の $0.5 \text{ kmol} \cdot \text{m}^{-3} \text{H}_2\text{SO}_4$ 中での最大量子効率とアノード電流密度の逆数の関係を示す。 Fe_2O_3 皮膜は

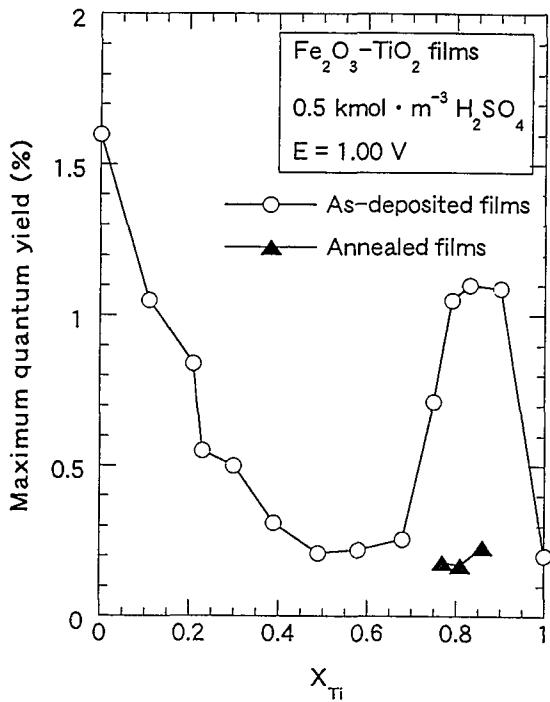


Fig.4 Maximum quantum yield in $0.5 \text{ M H}_2\text{SO}_4$ (pH 0.4) as a function of titanium cationic fraction for as-deposited and annealed $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ films.

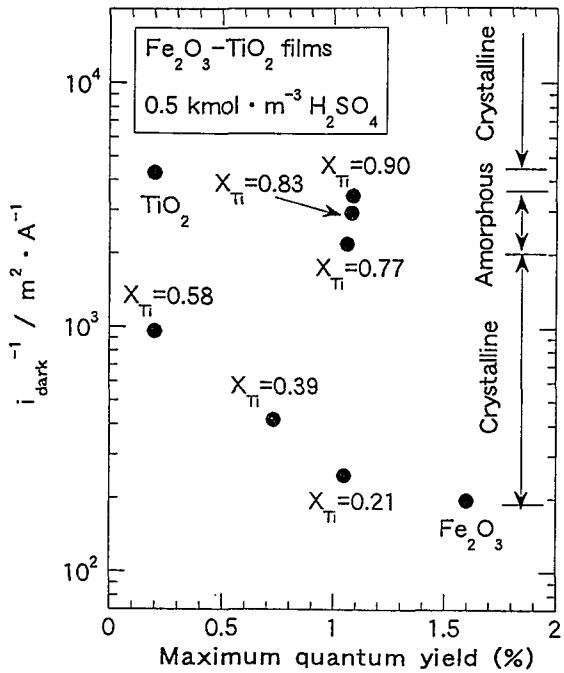


Fig.5 Current density under dark and maximum quantum yield for $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ film as a function of titanium cationic fraction of $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ film.

光電流応答特性は高いものの耐食性は低く、 TiO_2 皮膜は耐食性は高いが光電流応答特性は低い。しかし、 Ti(IV) カチオン分率 0.77–0.90 の $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜は、高い量子効率および耐食性を同時に示した。これは前述のように、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜がアモルファス構造のときである。このような $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の組成による耐食性と光電流応答特性との関係は、中性およびアルカリ溶液でも得られた。

第6章 総括

本章では、第5章までに述べた本研究で結果を総括し、要約している。

MOCVD 法により形成した $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜は酸性溶液中で優れた耐食性を示す。 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜は、電気化学的に分極した場合、カソード側では Fe_2O_3 成分の還元溶解が起こるが、アノード側では溶解しない。スパッタ Fe-Ti 合金の耐食性はア-ク溶解 Fe-Ti 合金のそれより高い。39at%以上のチタンを含有するスパッタ Fe-Ti 合金および57at%以上のチタンを含有するア-ク溶解 Fe-Ti 合金は、 $5 \text{ kmol} \cdot \text{m}^{-3} \text{HCl}$ 中で不働態を示す。そして、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜はこれらの Fe-Ti 合金の不働態皮膜より高い耐食性を示す。 Ti(IV) カチオン分率 0.70–0.95 の $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜は、pH に関係なく、高い量子効率と耐食性を同時に示す。 Ti(IV) カチオン分率 0.70–0.95 の皮膜が高い量子効率を示すのはアモルファス構造のときで、結晶化すると量子効率は低下する。

審 査 結 果 の 要 旨

$\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜は、強酸溶液中でも高い耐食性を示す高性能防食皮膜になることや高い化学的安定性と高い光電流応答特性を同時に示す半導体電極になることが期待されている。本論文は、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の耐食性と光電気化学的性質を明らかにすることを目的として、MOCVD法により $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜を形成し、各種環境中における皮膜の耐食性と膜組成の関係および光電気化学的性質と組成の関係を調べ、高い耐食性と高い量子効率が同時に得られる膜組成を求めた研究の成果を纏めたもので、全編6章よりなる。

第1章では、人工不働態皮膜の研究動向、本研究の背景および目的について述べている。

第2章では、本研究における実験方法として、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜およびFe-Ti合金試料の作製、試料の分析、耐食性の評価および光電気化学的特性の測定方法について述べている。

第3章では、減圧MOCVD法により合成した $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の耐食性と膜組成の関係について述べている。この系の皮膜は、Ti(IV)カチオン分率が約0.70まではスピネル構造、0.70以上ではアモルファス構造である。この系の皮膜は酸性溶液中で優れた耐食性を示し、基板温度673Kで析出した皮膜はTi(IV)カチオン分率が0.32以上になると、5kmol·m⁻³HCl中でも溶解しない。この系の皮膜を電気化学的に分極した場合、カソード側では Fe_2O_3 成分の還元溶解が起こるが、アノード側では溶解しない。このカソード分極域での皮膜の溶解速度は、電位が高くなるにつれて、また、同じ電位ではTi(IV)カチオン分率が大きいほど減少した。

第4章では、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の耐食性とFe-Ti合金の不働態皮膜の耐食性とを比較している。Fe-Ti合金はスパッタ法およびアーク溶解鋳造法で作製した。これらの合金を5kmol·m⁻³HCl中でアノード分極すると、スパッタ合金は39at% Ti以上で、またアーク溶解合金は57at% Ti以上で不働態化した。5kmol·m⁻³HCl中での $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の溶解速度とスパッタおよびアーク溶解Fe-Ti合金の不働態皮膜のそれを比較すると、膜中のTi(IV)カチオン分率が等しいとき、前者は後者よりも30~40倍くらい小さい。

第5章では、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の光電気化学的性質について述べている。この系の皮膜は、溶液のpHに関係なく、Ti(IV)カチオン分率0.70~0.95のとき高い量子効率と高い耐食性を同時に示す。Ti(IV)カチオン分率0.70~0.95の皮膜が高い量子効率を示すのはアモルファス構造のときのみで、結晶化すると量子効率は低下する。

第6章では、本研究の結論として、第5章までに述べた研究成果を総括し、要約している。

以上、要するに本論文は、MOCVD法による $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 系人工不働態皮膜の耐食性と光電気化学的性質を膜組成の関数として明らかにしたものであって、金属工学の発展に寄与するところが少なくない。

よって、本論文は博士（工学）の論文として合格と認める。